

Установка вакуумного напилення УВН-2М-2 для нанесення тонкоплівкових композицій: хром/алюміній/фтористий магній

Технічні характеристики та можливості:

- граничний вакуум у робочому об'ємі – $2 \cdot 10^{-5}$ мм.рт.ст.
- іонне очищення – розряд у змінному полі; вакуум - $5 \cdot 10^{-2}$ мм.рт.ст.
- напилення:
 - **хрому** з дротяного вольфрамового випарника; вакуум - $5 \cdot 10^{-5}$ мм.рт.ст.; контроль напилення – візуальний; товщина підшару – до 80 нм.
 - **алюмінію** з дротяного вольфрамового випарника; вакуум - $5 \cdot 10^{-5}$ мм.рт.ст.; контроль напилення – візуальний; товщина плівки – до 300 нм.
 - **фтористого магнію** з випарника молібденового човника; вакуум - $5 \cdot 10^{-5}$ мм.рт.ст.; контроль напилення – візуальний; товщина діелектрика – до 100 нм.



Установка вакуумного напилення УВН-2М-2



Підковпачне обладнання установки УВН-2М-2



Позиція наплення Al



Позиція наплення MgF2